

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Москвина Павла Владимировича «Повышение стабильности генерации интенсивных импульсных пучков в источниках электронов с плазменным катодом на основе дугового разряда низкого давления» по специальности 2.2.1 – вакуумная и плазменная электроника на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, Имя, Отчество	Бурдовицин Виктор Алексеевич
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности и отрасли науки, по которым защищена диссертация)	Доктор технических наук по специальности 01.04.04 «Физическая электроника».
Ученое звание (по какой кафедре/по какой специальности, номер аттестата)	Профессор кафедры физики
Основное место работы	
Почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети интернет (при наличии)	634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 40, ТУСУР (3822) 51-05-30, http://tusur.ru/ , office@tusur.ru
Полное название организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Наименование подразделения	Кафедра физики
Должность	Профессор

Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

№	Публикация
1	On the Electrical Strength of the Accelerating Gap in a Forevacuum Plasma Electron Source / V. A. Burdovitsin, L. J. Ngon A Kiki, E. M. Oks, F. A. Sukhovolsky. – Text : electronic // Technical Physics. – 2026. – Vol. 71, No. 1. – P. 25–28. – DOI: 10.1134/S106378422560122X.
2	Electron beam deposition of silicon-oxycarbonitride films in a nitrogen-containing hollow cathode discharge plasma in the fore-vacuum pressure range / V. A. Burdovitsin, A.A. Adronov, A.S. Klimov, L.J. Ngon A Kiki, E.M. Oks, F.A. Sukhovolsky. - Thin Solid Films.- 2025.- Vol. 815, P. 140634. - DOI:10.1016/j.tsf.2025.140634

3	Electron beam evaporation of silicon carbide for producing silicon-carbon coatings / V.A. Burdovitsin, I.Yu. Bakeev, L.J. Ngon A. Kiki, E.M. Oks, A.V. Tyunkov. - High Temperature Materials and processes. – 2025.-Vol. 29, Issue 1, 2025, pp. 1-7. DOI: 10.1615/HighTempMatProc.v29.i1.10
4	Plasma generation in a long, narrow, metal tube by electron beam injection / V. A. Burdovitsin, I. Y. Bakeev, K. I. Karpov and E. M. Oks. - Plasma Sources Science and Technology, - 2022. – Vol. 31, No. 5. P. 055008. DOI: 10.1088/1361-6595/ac6a0b
5	Operating Features of Assisted Hollow Electrode Discharge During Electron-Beam Evaporation of Aluminum in Oxygen in the Fore-Vacuum Pressure Range / V. A. Burdovitsin; L. J. Ngon A Kiki; E. M. Oks. - IEEE Transactions on Plasma Science.- 2024.-Vol. 52, Issue: 7.- P. 2766 – 2769. DOI: 10.1109/TPS.2024.3404453
6	Влияние рода газа на электрическую прочность ускоряющего промежутка форвакуумного плазменного источника электронов / В. А. Бурдовицин, И. Ю. Bakeev, К. И. Карпов [и др.] // Известия вузов. Физика. – 2022. – Т. 65, № 11 (780). – С. 26–30. – DOI: 10.17223/00213411/65/11/26.
7	Burdovitsin V. A., Karpov K. I., Bakeev I. Yu., Oks E. M. Discharge in a long metal tube with an electron beam generated by a forevacuum plasma–cathode electron source // Physics of Plasmas. 2022. Vol. 29, № 9. Art. 093503. DOI: 10.1063/5.0100290.
8	Burdovitsin V. A., Karpov K. I., Kiki L. J. N. A., Oks E. M. Aluminum oxide films fabricated by reactive electron-beam evaporation in the fore-vacuum pressure range // High Temperature Material Processes. 2024. Vol. 28, № 1. P. 1–8. DOI: 10.1615/hightempmatproc.2023048009.

Официальный оппонент



Бурдовицин В.А.

Подпись Бурдовицина:  Я подтверждаю.

Ученый секретарь совета ТУСУР



Прокопчук Е.В.

«30» 06

2026 г.

